



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种含有原位生成扩散障的复合涂层制备方法

文献类型: 专利

作者 孙超, 马军, 姜肃猛, 官骏, 李海庆, 王维新, 刘山川 and 闻立时

发表日期 2010-05-19

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及在高温合金基体上制备高温防护复合涂层的技术,具体地说是一种含有原位生成扩散障的复合涂层制备方法,它利用预先沉积的多层膜,结合相关的热处理制度,制备出一种能在高温条件下抑制涂层元素向基体扩散,从而提高涂层使用寿命的复合涂层。本发明的工艺流程是:先对高温合金基体进行预处理;再通过电镀工艺制备一层亚微米级的Re-Ni镀层;完成电镀后处理步骤后,在Re-Ni镀层之上依次沉积一层MCrAlY涂层和一层AlSiY涂层;最后对该多层膜进行相关热处理,在原Re-Ni镀层位置产生扩散障。本发明有效解决了高Re镀层的制备成本问题,通过简单的热处理即获得含有均匀、连续扩散障的复合涂层。

公开日期 2010-05-19

语种 中文

专利申请号 CN101709470A

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/66975] [↓](#)

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 孙超, 马军, 姜肃猛, 官骏, 李海庆, 王维新, 刘山川 and 闻立时. 一种含有原位生成扩散障的复合涂层制备方法. 2010-GB/T 7714 05-19.

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
143	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

